PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-006254

(43) Date of publication of application: 13.01.1987

(51)Int.Cl.

G03C 1/68

G03C 1/71 G03F 7/10

(21)Application number: 60-145483

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

02.07.1985

(72)Inventor: MIURA KONOE

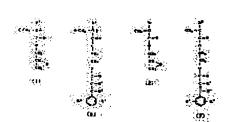
OCHIAI TAMEICHI MAKISHIMA HIDEO

(54) PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance dyeing resistance, to improve adhesion to a base and a dyed layer, and transmittance of the visible light and near UV rays, and the like, and to enable a dyeing–resistant insulating layer workable with the visible light and near UV rays by forming a photosensitive composition compound containing a sensitizing dye and a polymer having specified repeating units obtained by polymerizing a specified compound under conditions of an acid concentration ≤1 × 10−3mol per I in the reaction system.

CONSTITUTION: The photosensitive composition contains the sensitizing dye and the polymer having at least both of repeating units each represented by formulae (I) and (II), and the polymer can be obtained by copolymerizing the compounds represented by formula (III), such as glycidyl (meth)acrylate, and (IV), under conditions of an acid concentration ≤1 × 10−3mol per I in the reaction system, and the compound of formula (IV) is obtained by reacting hydroxyethyl (meth)acrylate with cinnamoyl halide or its derivative in a solvent in the presence of a base.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-6254

43公開 昭和62年(1987) 1月13日 广内整理番号 識別記号 @Int Cl.4 7267-2H 7267-2H G 03 C 1/68 1/71 7/10 審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁) G 03.F

感光性組成物 ❷発明の名称

> 创特 昭60-145483 賏

22出 昭60(1985)7月2日 願

横浜市緑区鸭志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合 近 衝 73発 明 者 Ξ 浦 研究所内

横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合 A 勿発 明 者 落 合

研究所内 @発 明

横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合 秀 夫 者 牧 鳥

研究所内 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

三菱化成工業株式会社

外1名 弁理士 長谷川 理 多代 人

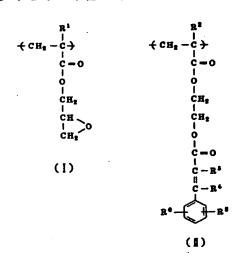
発明の名称 感光性組成物

仍出

頣

人

- 特許請求の範囲
 - 少くとも、下記式(I)及び(I).



(式中、 B1 及び R2 は水素原子又はメチル基 を表わし、R®は水泵原子又はフエニル基を表 わし、Bfは水素原子、フエニル基又はシアノ 盖を表わし、 B および B は水素原子、ハロ **ゲン原子、ニトロ苗又はメトキン基を表わす。)** で扱わされる繰返し単位を有するポリマーと 増感剤を含む感光性組成物であつて、該ポリ マーが下記式(II) および下記式(IV) で表わさ れる化合物を反応系内の酸過度が/×/0-* mel/4以下の条件下に重合して得られるもの であることを特徴とする感光性組成物。

(式中、R¹ ~ R⁶ は前記と同義を表わす。)
(2) 酸が、下記式 (V) で表わされるものである 特許請求の範囲第 / 項記載の感光性組成物。

(式中、 B^a ~ B^a は前配と同義を表わす。)
(3) 式 (IV) で表わされる化合物が、下配式 (VI)
かよび下配式 (VII) で表わされる化合物を反応させ、次いで、多孔質無根組体により精製処理することによつて得られたものである特許

請求の範囲第/項記載の感光性組成物。

るのが特に有用である。

直付型カラーフイルターを製造する場合、通常、固体操像業子の袋面を平担化し、ひずみのないカラーフイルターを得るためにポリマー層(以後「平担化」層と呼ぶ)を塗布する。その後その上に被染色層を形成するための感光性物質層をもうけ、しかる後に、

- ① 被染色層上にパターニングしたレジストを 設け、第出している被染色層の部分を染色し て染色層を形成後レジストを剝離し、その後 に同様にして次の染色値を形成する。(単一 の被染色層を複数の染色部分に染め分ける方 法。)
- ② 被染色層を所定のパターンに鄭光し、現像 した後染色して染色層を形成し、次いで、透明な耐染色性絶緻層を被模様、その上に同様 にして次の染色層を形成する。

上配①の方法は、各染色部分の境界における 色のにじみ等の問題があり、一般には②の方法 が広く行われている。 (式中、 R² ~ R⁰ は前配と同義を表わし、 X はハロゲン原子を表わす。)

3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、有機カラーフイルターの耐染色性 贈等として良好に使用し得る腐光性組成物に関する。

〔従来の技術〕

カラーフイルターの塔較方法には大別して次 の2つがあげられる。

- ① 例えば、シリコンウェーハー等の上に光検 知部等を設けてなる固体機像素子上に直接色 分解有機カラーフィルターを製造するもの (以下「直付型」と云う)。
- ③ 固体操像業子と色分解有機カラーフイルターを夫々個別に製造しておき、両者を位置合わせしつつ、適当な接着剤等で貼合わせるもの(以下「貼合わせ型」と云う)。

本発明の感光性組成物は量産性に優れていると考えられる直付型カラーフィルターに適用す

上記②の方法で得られるカラーフィルターに おいては、耐染色性絶縁層の選択が重要である。

耐染色性絶縁層は、第2色目以降の染色の際に、既に染色された第/色目の染色層の耐染色層としての役割と、出来上つたカラーフイルターの染色層の経時的な色のにじみを防止するという重要な役割を持つている。また、耐染色性絶縁層は、基本的に、耐染色性、蒸板及び染色脂との接着性、無色透明性、耐現像性、強膜性が良好であることが必要とされる。

しかしながら、これらの性質のいずれをも満足するようなものの選択は難しい。すなカチン、例えば、被染色層としては、通常、ゼラテール等とば、がなり、カゼイン、グリュー、ボリピーの形性やいかでは、変色性の観点があるが、染色性の観点からは現からは現からない。 突色性の観点からは現からになるが、染色層との接着性の観点からにものが要求されるといった相手盾した

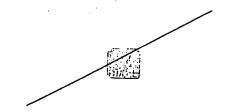
性質が要求されるからである。

(式中、 R¹ および B² は水栗原子又はメチル苺 を表わし、R⁴は水栗原子又はフエニル基を表わ

(式中、 R¹ ~ R⁶ は前配と同義を扱わし、 X は ハロゲン原子を表わす。)

しかしながら、式 (MI) で表わされる化合物は きわめて加水分解をうけやすいために保存中に 空気中に含まれる水分により加水分解をうけた り、或いは、ユーヒドロキシエチルアクリレー ト又はユーヒドロキシエチルメタクリレートと 反応させる際に系中に含まれる微量の水分によ し、R⁶ は水素原子、フェニル基又はシアノ基を 表わし、R⁶ および R⁶ は水素原子、ハロゲン原 子、ニトロ基又はメトキシ基を表わす。) 〔発明が解決しようとする問題点〕

前述のようなポリマーは、TDで表われる化合物、即ち、アクリル酸のグリンスステル又はメタクリルはののグルエステル又はメタクリルされると下記式(VI)で表わされるとドロキシルメタクロランスで、TDではその誘導体との反応が分けになった、アロニトリル、過酸化プンカルの方法に合物を使用し、公知の方法に合物とからなる。



り加水分解をうけるため、生成した式(N)で表 わされる化合物中には通常若干象の式(V)、

くはその誘導体が不純物として含まれている。 この不純物は、式(N)で表わされる化合物の性 質と類似しているため、アルカリ水で洗浄する などの通常の操作では充分には除けないのが実 状であつた。

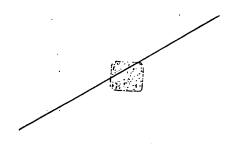
とのようにモノマー中に嵌を含んだままの状態で重合反応を行わせると、はなはだしい時は 反応中に酸の触媒作用により式(II) で姿わされる化合物のグリシジル基が架構反応をおこして ゲル化し、そうでない場合でも当該限は通常の 条件ではポリマーとの分離も困難であるため生成したポリマー中にとりこまれる。

とのようにして得られた樹脂は保存安定性に とぼしく数日から数週間の間にわずかながらゲ ル化が進行し、たとえば感光液組成物に調液後 0.2 μ程度のフイルターを用いて沪過するに際 して目ずまりをおこして頻繁に沪紙の交換を行 わねばならないなどの問題点が存在した。

[問題を解決するための手段]

本発明者等は上述したよりた欠点を解決すべく種々検討の結果、式(II) および(IV) で表わされる化合物を反応させる説、反応系内の酸の濃度が / × / 0⁻¹ mol/2以下の条件で重合を行わせるととにより保存安定性が著しく改善された感光性樹脂を製造出来ることを見出し本発明を完成した。

すなわち本発明の要旨は、少くとも、下記式 (1) 及び(1)



応系内の酸盪度が / × / 0^{-®} mol/ℓ以下の条件 下に重合して得られるものであることを特徴と する感光性組成物。

(式中、 B¹ ~ B⁰ は前配と同義を**袭わす。)** に存する。

本発明をさらに詳しく説明する。

式(I) で表わされる化合物は、アクリル酸の グリシジルエステルおよびメタクリル酸のグリ

(式中、 B^a 及び R^a は水梁原子又はメチル基を 表わし、R^a は水梁原子又はフェニル基を表わし、 B^a は水梁原子又はフェニル基を表わし、 B^a は水梁原子、ハロゲン原子、 ニトロ基又はメトキシ基を表わす。)で表わさ れる繰返し単位を有するポリマーと増感剤を含 む感光性組成物であつて、酸ポリマーが下配式 (¶) および下配式(N) で表わされる化合物を反

シジルエステルであり、市販されているものが 便利に使用出来る。

次に、式(IV)で表わされる化合物は、下式に 従って合成することによって得られる。

即ち、ヒドロキシエチルアクリレート又はヒドロキシエチルメタクリレート (VI) とケイ皮酸ハライドもしくはその誘導体 (VII) を塩基の存在下で溶媒中で反応させる。塩基は反応の進行に従つて発生してくる塩酸を捕獲するためのものでどのような塩基でも使用出来るが通常トリエ

チルアミンなどの第3級有機アミン、ピリジンなどの複葉環塩基性化合物、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドなどの第4級アンモニウムヒドロオキシド、ジアザビンクロウンデセンなどの有機強塩基、水酸化ナトリウム、
炭酸ソーダなどの無機塩基が好適に使用される。
これらの塩基はかならずしも溶液状態で存在する必要はなくけん濁状態で存在していても良い。

溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン(THP)、ジオキサン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサンなどのケトン系溶媒、インタン、ヘキサンなどの炭化水素ペンセン、トルエンなどの芳香族炭化水素、ジクロルエタンなどの水物性の小さい塩基性溶媒を塩基の働きもかねて使用することも出来る。

反応は-/0℃~+80℃、好ましくは-s で~+s0℃の間で行われる。この反応は著し い発熱反応であるので通常全体を一度に混合せ

が充分遅いものであれば何でもよいがヘキサン などの炭化水素、トルエン、ベンゼンなどの芳 香族炭化水素、クロロホルム、メテレンクロラ イドなどのハロゲン化炭化水素もしくはこれら の混合溶媒などが好適に用いられる。

とのようにして得られた (N) と (II) 、 さらに必要ならば他のモノマーを混合して溶媒中に溶解しラジカル開始剤を用いて重合を行う。

格族としてはラジカル連鎖移動定数が充分小さくかつ中性のものであれば特に制限はないがペンセン、トルエンなどの芳香族炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル系溶媒、アセトン、メテルエテルケトンなどのアルコール系溶媒などが好適に用いられる。

ラジカル開始剤としては過酸化ペンゾイル、 モープチルパーオキシドなどの過酸化物、アゾ ピスイソプチロニトリルなどのアゾ系の開始剤 が好適に用いられる。

反応系内に存在する酸又は塩苗の微度は/×

/0- * mol/2以下、好ましくは / × /0- * mol/2以下、好ましくは / × /0- * mol/2以下となるようにする。 (Ⅳ) を前述のような方法で合成、精製すればこの条件は容易に達成出来る。

反応温度、反応時間は使用する開始剤、存媒によって異なるが通常30℃~150℃、好ましくは40℃~130℃で1時間~30時間、好ましくは3時間~20時間反応を行う。

反応終了後は反応液にローへキサン、ローペンタンなどの貧溶媒を加えポリマーを析出させるか又は蒸留により溶媒を除くことによりポリマーを単離することが出来る。必要ならばさらに再沈法などによりポリマーを精製しても良い。

本発明のポリマーは、テトラヒドロフラン (THF)中、30℃での固有粘度が通常、 0.05~3d/5、好ましくは、0.1~2.0d / 5、特に好ましくは、0.2~1.5d/5の範 囲のものが好適である。増感剤としては、公知 の種々のものが使用できる。例えば、アントロ ン、ペンソフェノン、フエナントレン、ミヒラ ーケトン、ューニトロフルオレン、 s ーニトロアセナフテン、クリセン、ョーニトロアニリン、ューペンゾイルメチレンー 3 ーメチルナフトチアゾリン、ペンジル、ドーアセチルナフトチアゾリン、ペンジル、ドーアセチルー 4 ーニトローノーナフチルアミン、アントラキノンなどのいわゆる三重頂増感剤が好適に対して 0.1~20 重量 5、好ましくは、 0.s~10 重量 5 が用いられる。

通常は上記ポリマー及び増感剤双方を溶かすような溶媒、例えば、エチルセロソルブ、メチルセロソルブ等のセロソルズ系溶媒、もしくは、ジメテルホルムアミド(DMP)、ジメチルスルホキンド(DMP)、ジメテルスルホキンド(DMSO)、Nーメテルビロリルなどの溶媒に溶解して感光液として供せられる。感光液そのものは、通常含すされる増感剤のたった。

等が設けられているが、図面には省略した。

この平担化階をの材質、ポンディングパッド 8の加工方法については後に耐染色性絶線層 7 の説明と合わせて詳細に述べる。

次いで平担化層を上にゼラチン、カゼイン、 グリユー、アルブミン等、或いは、ポリビニル アルコール等の合成ポリマー等の水溶性ポリマ ーと重クロム酸アンモニウム等の重クロム酸塩 で募板上に薄膜を作り、可視光・近紫外光等で 露光後。現像すれば、増感剤は容易に洗い出さ れて無色遊明のポリマー腐を得ることが出来る。

以下本発明の感光性組成物を用いたカラーフィルターの一例につき図面を用いて更に詳細に説明する。

第 / 図(a) ~ (j) は 直付 型 カラー フイルター の 製造工程の一例を示す 説明図 である。

図中/はシリコンウェハー、2は光検知部、3は保護膜、4は平担化層、5は被染色層、6はマスク、7は耐染色性絶縁層、8はポンデイング・パッド、9は被染色層、10は表面層、をそれぞれ示す。

直付型カラーフイルターの場合は固体操像果子面上に直接カラーフイルターが設けられるものであり、その基体となる固体操像繋子は例えば第1図(a)に示すようなシリコンウェハー 1に 光検知部 2 が設けられ、その上面にリンガラス、石英等の保護 度 3 が設けられた構造とされている。固体操像業子にはその他、走査艇、適光膜

との混合物を強布して被染色脂 3 を構成するための感光性物質層を形成する (第 / 図(e))。

被染色層 s を構成するための感光性物質層は、通常、 $0.7 \sim 2 \mu$ となるように設ける。

次いで、被染色層 s を構成するための感光性物質層上に所定のパターンを有するマスク 6 を通して露光する (第 / 図(d))。 被染色脂 s を構成するための感光性物質には、通常、 4 4 0 ~ 3 8 0 am に感光性をもたせるようにするので、かかる領域の波長を有する高圧水級 短等を光源として露光する。

次いで、水で現像して所定のパターンの被染色層5を構成する部分を形成し(第/図(*))、 所定の分光特性を有する第/色目の染料で公知 の方法に従い染色して被染色脂5を形成する。

次いて、耐染色性絶縁層)を形成するための 感光性樹脂組成物を被覆する(第/図(t))。本 発明においては、耐染色性絶縁層)の形成には、 本発明においては前配式(I)、(I)及び(II)で 表わされる単位を有する共重合体と増腐剤との 次いで、エチルセロソルプやメテルエチルケ」推を用いることもあれば、シアン、緑、黄の補色系の3種を用いることもある。その際、例えば、第1のシアンの被染色層に、第2の黄の被染色層を一部度なるように形成して、その重なり部分で第3色目の緑色を得るようにしてもよい。

通常、最上部の被染色層上に、表面の平滑化、 或いは染色層の保護のために表面積 / 0 を設け

に応じ適宜選択決定すれば良い。但し上記感光 性組成物の物性上、平担化層よりも耐染色性絶 緑層として用いるのが好ましい。他の感光性樹 脂としてはポリグリシジルメタクリレート、ポ リメチルメタクリレート、ポリメテルインプロ ペニルケトン、メチルメタクリルアミド、ポリ ヘキサフロロブチルメタクリレート、ポリプテ ンーノースルホン等種々のものが用い得る。 〔実施例〕

以下実施例により本発明を更に具体的に説明する。

実施例/

[モノマーの合成]

ヒドロキシエチルメタクリレート339とピリジン349をテトラヒドロフラン84mlに溶解する。ケイヒ酸クロライド309のテトラヒドロフラン30ml容液を上配溶液にかくはんしながら30分で流下する。

このときの反応温度を s ~ / 0 ℃の間に制御する。 満下が終了してから上記温度で 4 時間反

る、。

表面層 / 0 としては、強度、透明性、中間層及び染色層との密着性及びポンデイング・パッド部などの加工性が要求され、その要求を満たしたものならなんでもよいが、前述の感光性組成物を使用しても良い。

表面層 / 0 は通常 0 . / ~ 2 μ の膜厚となるように設けさらに 単光現像して所定のポンディング・パッドなどの加工を行なう {第 / 図()} }。

以上のようにして、本発明のカラーフィルターを得ることが出来るが、本発明のカラーフィルターの平担化階もしくは耐染色性絶縁層は耐染色性が完全であり、基板或いは染色層との接着性が良好であり従つて鮮明な面像を得ることが出来るのである。

本発明においては平担化層および/または耐染色性絶縁層として上記した特殊の感光性組成物を用いるものであるが、本発明においては上記感光性組成物からなる層を少なくとも一層設け、他は他の樹脂層等とすることもでき、用途

応させて反応を完了する。

反応後生成したピリジン塩酸塩を沪過し除去する。ついで沪別した反応液に脱塩水 J O O m8 を加えて生成物と相分離させる。

ついで、テトラメチルアンモニウムハイドロオキシドノ 多水溶液 3 0 0 単で洗浄を 3 回くり返し、更に脱塩水 3 0 0 単で洗浄を 3 回くり返して粗生成物を取り出すことができる。

との時の収量は 3 6.0 g (収率 3 5 5) である。

上述の租生成物 2 0 9をシリカゲル(5 0 0 9)カラムにかけクロロホルム/ョーへキサン(ーチ/ / wt)混合溶媒で展開し精製する。流出物を薄層クロマトグラフィーで分析しケイ皮酸の全く認められないフラクションを集め展開溶媒を減圧蒸留により除き目的物を得る。

収量 / /.5 g (5 7.5 %)

[ポリマーの合成]

クリンジルメタクリレート 1 9.5 g、前送の ミンナモイルオキシエチルメタクリレート10.7 を p - ジオキサン / 5 0 ㎡ に溶解し 3 0 分望 業でパブリングする。ついで窒素雰囲気を保つ たまま 6 0 ℃ に加熱し、アゾビスイソプチロニ トリル 0 3 7 9 を加え 6 0 ℃ で 6 時間反応させ る。反応系内の酸及び塩基の酸酸は / × / 0 - 6 mol/4 以下であつた。

反応終了後反応混合物を 4 5 0 配の a ー へキサンに満下しポリマーを析出させ、析出したポリマーを炉別後 9 5 配のアセトンに落解し 300 配のメタノール中に満下して再沈し、炉別後波圧下に乾燥する。

収益 2 5.4 9 (8 4.1 多) 78P/C = 0.5 4 (THP中 3 0 C C = 0.2 9 / dt)

[感光剤の調液]

- (4) 耐染色性 …… 遊明性を評価したと同様の基板を後にのべるカラーフイルターの染色条件と同じ条件で黄色又はシアンに染色しリンス 後週明性を評価したと同じように分光透過率を求めた。
- (5) 密藩性 …… 粘潜テーブ(セロハンテーブ)を指圧によりよく接殺し、これを糾離することによりガラスとの接務性を評価した。また平担化層の上面に実施例と同様にしてゼラチンの被染色層を形成し、上記と同似粘箔テーブで接着強度を評価した。評価基準は次配の

シリコンウェーハー上にスピンコーテング法 (2500 spm)で1.0 pの厚さに適布し、感 度、解像力、接着性についてそれぞれ以下にの べるような方法で評価を行つた。なお耐染色性、 透明性についてはシリコンウェーハーのかわり に0.5 mpテンパックス製ガラス基板上にシリ コンウェーハーの場合と同様に塗布したもので 評価を行つた。

- (2) 解像力 …… トッパン糊製解像力テストチャ

通りである。

〇:全く剝離しないもの

×:一部でも剝離の見られるもの

(6) 保存安定性 …… ゲル化の進行度をみるため に再度 0・2 μの沪過を行いゲルにより目づま りのため沪過不能となる日数を求めた。 結果 を扱くにまとめる。

比較例

実施例 / と同様にしてシナモイルオキシエチルメタクリレートの租生成物を得た。 この の 関塩 基満 定を 行つた 結果 約 4 重 量 多 の ケ イ 皮 酸を 含ん でいる ことが 判明 した。 反応 系 内 の を 精製 せずに そのまま 突施 例 / と 同様 に グ リ い の 酸 度 は 8 × / 0⁻⁸ me 1/2、 塩 基の 機 度 は 1 0⁻⁶ me 1/2、 塩 基の 機 度 は 1 で あ つ た 。 生 じ た ポ リ マー を 用 い て 感 光 液 に 調液 し 実 施 例 と 同様 に 評価 し た 。 約 果 を 表 / にまとめる。

猤

5	/祖E	1	感	皮	解像力	透明性	耐染色性	密着性	保存
	例								安定性
		٦	300m) Cal	2.5 μ	全領域	全領域	0	>3ヶ月
果	施例	'				T>98%	T>98%		
Н	2 較 1	BI.	闽	Ł	间上	同上	同上	0	<i>3</i> B

実施例 2

ローNsG (日本化薬(ೣ製) (カヤノールは日本化薬(ೣの商品名)の約 0.1 多水溶液中に 1 s C、 / 分間浸漬し染色処理して被染色層を形成した。

次いで平担化層と同じ組成の感光性組成物を 旗厚が 0.5 μとなるようにスピンコーテイング 塗布し、平担化層の場合と同様に露光、現像、 熱キュアして透明でかつボンデイング・パッド 部などの加工がなされた耐染色性絶縁層を形成 した。

次いで、この耐染色性絶縁層上に、前述と问様にしてゼラチンー重クロム酸アンモニウム層を形成し、前述と同様に越光、現像した後、酢酸で PH を 4 に調整した、ダイアクロンターキスブルー G P 「(三菱化成工業瞬製)(ダイアクロンは三菱化成工業瞬の登録商標)の約 0.3 多水溶液で 7 5 C、/ 分間染色処理して被染色層を形成した。

次いで、保護膜として平担化層と同じ感光性 組成物を膜厚 0.5 p となるようにスピンコーテ odのエネルギー量で鮮光した後 2 0 でのメチルイソプテルケトンとイソプロビルアルコールの 7 : / (vol / vol) 混合溶媒で / 分間スプレー現像した。さらにメチルイソプテルケトンで / 分間リンスを行つた。得られたポンデイング・パッド部などの加工がなされた平担化層は、 黄色みが消え透明な層であつた。

ついで!s0℃で!s分間ポストペークを行い無キュアした。

酢酸で pH を 4 に調整した「カヤノールイエ

イングにより塗布して前配と同様の条件にて露 光、現像してポンデイング・バッド 部等の加工 のなされた透明な袋面層を形成しカラーフイル ターが直付された固体カラー操像素子を得た。 〔発明の効果〕

とのように本発明の組成物によれば耐染色性に優れ、基板及び染色層との接着性、可視、近紫外線に対する無色透明性等が良好で、しかも可視光線、近紫外光線を用いて加工可能な耐染色性絶縁層を形成することができる。

図面の簡単な説明

第 / 図(a) ~(j) は直付型カラーフイルターの製造工程の一例を示す説明図である。

図中/はシリコンウエハー、2は光検知部、3は保護膜、4は平担化層、5は被染色層、6はマスク、7は耐染色性絶縁層、8はポンデイング・パッド、9は被染色層、10は表面層を表わす。

